# 设计低功耗光开关 应对日益增长的网络流量

为了推动通信技术和高性能计算产业的发展,华为技术有限公司加 拿大分公司正致力于研发热光型硅光开关。借助仿真分析对设计进 行优化,力图最大程度地提升光开关的转换速度,同时将器件的功耗 降至最低。

#### 作者 JENNIFER SEGUI

早在数十年前,研究人员就设想过全光学传输网络,希望 利用其高速传输的潜能来满足人们对网络性能不断增长的需 求。目前,光开关已经被广泛部署在城际网络和远程网络中, 数据中心的相关实验及高性能计算的研发也正在持续地同步 推进中。华为技术有限公司加拿大分公司(以下简称"华为") 正在研究如何利用硅光(SiPh)技术从根本上提升核心光学元

Splitte

件(如光开关)的性能。

光学网络利用光波进行 数据传输,拨打电话、处理 搜索请求或电子邮件都是光 学网络常见的用例。网络中 的各个点之间要进行数据传



图 2. 在 MZ 干涉仪中, 光进入输入波导后被分成两束并分别进入两个支臂, 光波会根据每个支臂的光学特性 在其中产生相移。耦合波会在输出端口发生相长干涉和相消干涉, 分别表示光开关的交叉态和直通态。绿色路 径显示的是开关的默认状态。图注: Input - 输入; Splitter - 分流器; Output - 输出; Coupler - 耦合器; Bar State -直通态; Cross State - 交叉态

Couplei

Cross State

输,传统方法是先将光信号 转换成电信号,完成交换 后,再将电信号重新转换回 光信号(见图1)。转换信 号时需要使用大型高耗电设 备,这会导致每转换一个数 据包都会增加延迟时间。相 比之下,光开关无需转换信 号格式,因此这种开关往往 交换更加快速、尺寸更加小 巧,并且具有更低的功耗。

然而,目前的光开关 不仅体积庞大,而且价格昂 贵,许多元件还需要人工组 装。为了解决这些问题,华 为正在利用集成硅光技术开 发一种新型光路,这种光路 是在 CMOS(互补金属氧化 物半导体)芯片代工厂中利 用约 0.5 微米宽的硅波导进 行生产的。这项技术得以实 现是因为硅在信号波长范围 内是透明的。

华为的开发人员们正借 助集成设计环境来制作一些 世界上最复杂的硅光路原型 机。在整个迭代的原型开发 周期中,开发人员会不断调 整数值物理模型以提高其精 度,同时还借助光路设计软 件来确保芯片设计可一次成 功。热光型硅光开关的热力 学性能分析是整个设计工作 流程的核心环节。

### ≫ 采用相移型热光开关 交换数据

研发中的热光开关 是一种硅光马赫-曾德尔 (Mach-Zehnder,简称MZ) 干涉仪,具有交叉和直通两



热器; Output - 输出



图 4. 上图和下图分别显示了无热 下切和有热下切的 MZ 热光开 关的加热波导臂剖面图。热下切 可以将波导和加热器隔开,从而 减少热量向周围材料的散失。图 注: Heater - 加热器; Buried - 埋 层; Si substrate - 硅衬底

种状态。默认情况下,MZ 干涉仪处于交叉状态(见 图2)。光波在到达输入端 口(如端口1)时被分成两 束,并沿两条支臂传播。当 两支臂中的光在到达输出耦 合器时会发生干涉,其相对 相位导致最终所有的光都会 从输出端口2输出。

热致相移为我们提供了 一种切换开关状态的方式。 通过对其中一条支臂进行加 热,可将 MZ 热光开关切换 到直通态。加热过程可以改 变波导的折射率,从而使在 这条支臂中传播的光产生 π 相移。干涉作用使得光从输 出端口1输出,由此将数据 传送到不同的目的地。通过 将大量的开关单元集成到单 个芯片上,可以制造一个大 型的开关矩阵。 开关设计。当光进入开关 后,在两条折叠的波导臂 (蓝线表示)中被分成两 束。其中一条支臂上配备 了氮化钛(TiN)电阻加热 器,图3中用粉色阴影区 域表示。在对接触电极施加 电压后,加热器底层波导的 温度将会升高并产生 π 相 移,从而引起开关状态的改 变。三折波导可以增加加热 器与波导相互作用的距离, 如此一来,便能将效率提升 至原来的三倍。

图 3 展示了华为的 MZ

图 3 中展示的热光开 关的加热波导臂是一种悬 挂结构,通过刻蚀掉其周 围的包层材料,形成了热 下切(thermal undercut)。 图 4 显示了有热下切和无 热下切时的加热波导臂的剖 面图。热下切可以防止向底 层基板传热,促使加热器对 掩埋式波导的升温效率提高 23倍,并因此减少了96% 的功耗。

#### >> 热分析和设计优化

不仅要同时满足功耗、 交换速度及尺寸的要求,还 需要考虑热下切的制备设计 规则,这使得对 MZ 热光开关 进行优化面临着很大的难题。 为了确定最终设计,研究人 员借助 COMSOL Multiphysics<sup>®</sup> 软件的热分析能力,能够在 制造物理原型之前对创新设计进行有效的定量评估。

"在产品进行大规模量 产之前,我们需要对设计进 行彻底的优化。在这一过程 中,每毫瓦的功耗都不容小 觑。"华为高级研发工程师 Dritan Celo 说道。鉴于此,他 们在硅光器件的集成设计环 境中启用了 COMSOL<sup>®</sup>软件。

举个例子,热分析被用 来对不同热光设计的性能进 行量化分析。因为热下切的 存在会给制造过程增加额外 的步骤,所以是否在热光设

**66** 在产品进行大规模量产之前,我们需要进行 彻底的优化工作,在这一过程中,每毫瓦的 功耗都不容忽视。

— DRITAN CELO,华为高级研究工程师

#### 热光开关设计



图 5. 利用 COMSOL Multiphysics<sup>®</sup> 软件建立的热光开关模型,上三张图和下三张图分别显示了无热下切和有热下切的情况。左侧的两张模拟 图显示了稳态温度分布、中间的两张图谱显示了加热器与波导之间的温差、右侧两张图谱显示了波导达到目标温度所需时间的瞬态分析。 图注:Without Thermal Undercut - 无热下切;With Thermal Undercut - 有热下切

计中加入热下切成为了一个 需要被着重考虑的因素。另 外,尽管使用热下切有助于 减少器件的功耗,但同时会 降低交换速度,所以具有下 切的器件几何结构只适用于 一些特定的应用领域。

图 3 中显示了在 COMSOL<sup>®</sup>软件中绘制的器 件几何结构,其中包括无热 下切和有热下切这两种情况。为了缩短每次设计中稳 态热分析所需的计算时间, 基于结构的对称性(在图3 中以黑色虚线表示),研究 人员仅使用了对称结构的 一半。生成的几何结构模型 见图5(左侧的两张图), 长度为数百微米的硅波导 嵌在硅衬底顶部的二氧化 硅中。软件中提供了大量 的材料属性选项,研究人 员可以方便地从中选择适 当的材料属性来定义模型 的各个域。由于硅光结构 高度的深宽比为1000:1, 因此 COMSOL Multiphysics<sup>®</sup> 提供的网格剖分算法是快速 准确建模的关键。

研究人员对整个器件 几何结构中的固体传热进行 了建模,对表面钝化层和热 下切边界(仅针对有热下切 的设计)定义了绝热边界条 件。他们将加热波导臂中的 氮化钛加热器定义为开关模 型中的热源,仿真结果显示 了使特定设计产生 π 相移需 要施加的热能。为产生 π 相 移,波导温度必须以 13.3 K 为单位变化量——这一数 值是由光学测量实验确定 的。

热光型硅光开关的稳 态分析表明,当设计中存 在热下切时,实现 π相 移的功耗可降低23倍。 图 5 中左侧的两张模拟图 显示了每个器件中的温度 分布情况。中间的两张图 谱显示了加热器与波导之 间的温差,同时表明了无 下切器件向周围材料散热 的程度。与无下切设计中 13 K 的温度差相比,具有 下切的设计中温度差仅为 0.2 K。瞬态分析采用了对 称结构的四分之一,用于 进一步缩短计算时间。瞬 态分析揭示了将波导调节

到期望温度和相位所需的时间,该时间的长短限制了器件在交叉态与直通态之间的切换速度。尽管有下切的器件更加节能,但它们的调节速度却比不上无下切的器件。图 5 中右侧的两张图谱中显示的上升和下降时间就说明了这一点。

在评估二氧化硅层的厚 度、MZ开关的外形尺寸、器 件顶部钝化层的冷却效应等 方面的过程中,通过验证的 稳态和瞬态模型同样起着至 关重要的作用,使器件最大 限度地受益于功耗的降低。

## » 成千上万的开关 集成在单个芯片中

尽管传热仿真的主要目

的是针对单个 MZ 热光开关 进行优化,然而在实际应用 中,这些开关并不会单独出 现,而是用来组成大型的开 关阵列(见图 6)。华为研 究人员设计这个阵列的目的 是为了防止光学串扰,以确 保从开关发出的光信号清晰 准确。图 6 的上图显示的 架构表示一个"32×32"硅 光开关阵列,其中包含 448 个 "2×2"的 MZ 热光开关 单元。每列中都有一条光路 穿过其中的一个单元,通过 对这些单元施加适当的交叉 或直通驱动功率可对光路的 路径进行定义。对开关供电 会使底层波导升温并产生必 要的 π 相移,从而使信号 沿选定的路径传播。

图 6 中下图显示了 "32×32"开关阵列的实体





图6.上图显示了包含448个"2×2"热光MZ单元的"32×32"开关阵列, 下图显示的是制作原型机,其中的每个单元都在芯片上集成了监控光电 二极管。

制作原型,它由具备使用热 下切技术来制造硅光器件经 验的 CMOS 代工厂生产。这 个原型的每个单元都在芯片 上集成了监控光电二极管, 其目的是用来确定交叉或直 通驱动电流。这一原型的实 现标示着该研究工作取得了 重要进展。

进入原型设计和产品 大规模量产阶段后,设计者 们又迎来了新的挑战。他们 需要在华为内部研发中心和 代工厂之间合理分配时间。 "热力学性能虽然只是一个 很小的方面,但却是整个器 件设计工作流程中的一个重

要环节。"Celo 解释道,"产 品的大规模量产阶段即将到 来, 在制造'128×128' 硅 光开关的过程中,要将成千 上万的 MZ 单元集成在单个 芯片上,同时功耗还需控制 在 50 W 以内。并且生产出 来的开关可能会在各种不 同的环境中使用,这又对产 品的机械稳定性提出了要 求。目前,对封装开关的 结构分析成为了我们关注 的焦点。我们将继续利用 COMSOL<sup>®</sup> 软件的数值仿真 功能对设计进行优化,相信 这个软件将再次成为我们工 作中不可或缺的一部分。" ◎



华为技术有限公司加拿大分公司先进光子学团队成员: Dritan Celo、 Eric Bernier 和 Dominic Goodwill。

## 参考文献

D. Celo, D. J. Goodwill, J. Jiang, P. Dumais, C. Zhang, F. Zhao, X. Tu, C. Zhang, S. Yan, J. He, M. Li, W. Liu, Y. Wei, D. Geng, H. Mehrvar, E. Bernier. 32x32 Silicon Photonic Switch, presented at Optoelectronics and Communications Conference/International Conference on Photonics in Switching, Niigata, Japan 2016.

D. Celo, D. J. Goodwill, J. Jiang, P. Dumais, M. Li, E. Bernier. Thermo-optic silicon photonics with low power and extreme resilience to over-drive, presented at IEEE Optical Interconnects Conference, San Diego, CA 2016. DOI: 10.1109/OIC.2016.7482994, IEEE.

21